

□ 別紙

特許出願第2001-79788号

弊コメント

1. 拒絶理由1につきまして、

本件に対して担当審査官(SEONG, Baeg-Doo)と電話(2003年12月12日)しましたところ、本発明の請求の範囲の請求項1, 3, 4に記載されている“not exceeding 200 μm ”及び“not exceeding 15 μm ”について、その権利範囲が広範囲で不明瞭であると主張しておりました。

つきまして、これに対する弊所の意見としては、拒絶理由を解消するために、上記記載のうち“not exceeding”を削除するか、該下限を具体的に記載する方が好ましいと考えられますので、何卒、ご検討の上、貴ご高見を御教示下さいますようお願い申し上げます。

2. 拒絶理由2につきまして、

本願発明は、各配線上に形成された溝が内部で発生する応力を分散させて、基板に作用する配線の力を弱め、サイドクラックと端部クラックの発生を抑制し、また、剥離の発生を抑制することができるし、一列の複数の溝は応力を有利に分散させることを特徴とするもので、このような効果が引用例(日本国特開平8-34110号)には記載されていないと考えられます。

然しながら、担当審査官は、拒絶理由に記載の通り、引用例において“素子電極間隔．．．”に基づいて上記のような効果が示唆されていると判断しているように思われますので、本願発明と引用発明との差異を明らかにするために、請求項1、9、10に凹部の厚さを付加して記載する方が望ましいと考えられますので、何卒、これについて、ご検討の上、貴ご高見を御教示下さいますようお願い申し上げます。

以上

※本件の受領確認をRETURN FAXでお願い申し上げます。

発送日付：2003.11.28.

提出期日：2004.01.28.

特 許 庁
意見提出通知書

出 願 人 キヤノン株式会社

代 理 人 慎重勲 外 1 名
大韓民国 SEOUL特別市 瑞草区 瑞草4洞 1678-2 東亞Villart 2 Town 302号

出願番号 10-2001-0079788

発明の名称 SUBSTRATE HAVING FINE LINE, ELECTRON SOURCE AND
IMAGE DISPLAY APPARATUS

この出願に対する審査の結果、下記のような拒絶理由があるので、特許法第63条の規定によりこれを通知しますから、意見があるとか補正を要する場合には、上記提出期日までに意見書[特許法施行規則別紙第25号の2書式]又は／及び補正書[特許法施行規則別紙第5号書式]を提出されたい(上記提出期日に対して、毎回1月単位で延長を申請することができ、この申請に対し別途の期間延長承認の通知は行いません)。

【理由】

1. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記に指摘の通り不備であるので、特許法第42条第4項に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。
2. この出願の特許請求の範囲の請求項1-12に記載された発明は、その出願前にこの発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が下記に指摘したものに基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

— 記 —

1. 本発明の請求の範囲の請求項1, 3, 4において、“not exceeding 200 μm ”、“not exceeding 15 μm ”のように、数値に対する下限を具体的に記載しておらず、請求項8の“加熱”において何度で加熱されるか記載されていないから不明瞭である。
(特許法第42条第4項第2号)

2. 本願発明は基板に関するもので、fine lineは、該fine lineの長手方向の少なくとも一部に、 $200\mu\text{m}$ を超えない間隔で配置された複数の凹部を含むことを特徴とするが、これは、日本公開特許公報平8-34110号('96.2.6.)において、ステンレスワイヤの線径がそれぞれ230メッシュ、線径 $25\mu\text{m}$;300メッシュ、線径 $20\mu\text{m}$;350メッシュ、線径 $16\mu\text{m}$ のステンレスメッシュが開示されており、素子電極間隔は $2\mu\text{m}$ 、素子電極間隔の長さは $200\mu\text{m}$ 、素子電極は $300\mu\text{m}$ に形成された技術が開示されているので、上記引用発明に基づいて、この発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものである。(特許法第29条第2項)

[添付]

添付1 日本公開特許公報平8-34110号写し1部

2003.11.28.

特許庁

발송번호 : 9-5-2003-047649076
발송일자 : 2003.11.28
제출기일 : 2004.01.28

수신 : 서울 서초구 서초4동 1678-2 동아빌라트2
타운 302호
신중훈 귀하

137-882

특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 캐논 가부시끼가이샤 (출원인코드: 519980959073)
주소 일본 도쿄도 오오따꾸 시모마루고 3쵸메 30방 2고
대리인 성명 신중훈 외 1 명
주소 서울 서초구 서초4동 1678-2 동아빌라트2타운 302호
출원번호 10-2001-0079788
발명의 명칭 미세라인을 가진 기판, 전자소스 및 화상형성장치

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제 25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장 승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

1. 이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.
2. 이 출원의 특허청구범위 제1-12항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

- 아래 -

1. 본 발명의 청구범위 제1항, 제3항, 제4항에서 "200 μ m를 초과하지 않는" "15 μ m를 초과하지 않는"과 같이 수치에 대한 하한을 구체적으로 기재하지 않았고, 제8항의 "가열"에서 몇도로 가열되는지 기재되지 않아 불명료합니다. (특허법 제42조제4항2호).
2. 본원 발명은 기판에 관한 것으로 미세라인은 이 미세라인의 길이방향의 적어도 일부에 200 μ m를 초과하지 않는 간격으로 배치된 복수의 오목부를 포함하는 것을 특징으로 하나, 이는 일본 공개특허공보 평8-34110호('96.2.6)에서 스테인레스 와이어의 선경이 각각 230 μ m, 선경25 μ m; 300 μ m, 선경20 μ m; 350 μ m, 선경16 μ m의 스테인레스 메시가 개시되어 있고, 소자전극간격은 2 μ m, 소자전극의 길이는 200 μ m, 소자전극은 300 μ m로 형성되는 기술이 개시되어 있어, 상기 인용발명에 의하여 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것입니다. (특허법 제29조제2항).

[첨부]

첨부1 일본 공개특허공보 평8-34110호 사본 1부 끝.

2003.11.28

특허청

심사4국

반도체2심사담당관실

심사관 성백두



출력 일자: 2003/11/29

<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5754 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터